







**GEN.002** 

Código do produto: **GEN.001** 

Rua Luiz Vaz de Camões, 177 : cep 07210 007 : Cumbica : Guarulhos / SP : tel. 55 (11) 2171 8000 : fax 55 (11) 2171 8030 : www.genesistintas.com.bu

### **BOLETIM TÉCNICO**

Produto: **ETCH RESIST AZUL** 

**ETCH RESIST CINZA** 

CIRCUITO IMPRESSO Data: 25/01/10

### **CARACTERÍSTICAS**

Tinta serigráfica à base de resinas sintéticas e solventes aromáticos especiais, resistente à corrosão ácida.

## **INDICAÇÕES**

Linha:

Para uso na confecção de circuito impresso, com aplicação de Percloreto de Ferro ou Cloreto Cúprico como agente corrosivo, e remoção da película através de soluções álcalis ou solventes.

#### **PROPRIEDADES**

Foi desenvolvida visando a facilidade de impressão e nitidez excepcional, com secagem rápida, apresentando boa aderência e fácil remoção com álcalis e jato de água. Depois de seca, a camada apresenta boa definição de detalhes, acabamento acetinado para maior facilidade de retoques, além de excelente resistência mecânica.

### **CARACTERÍSTICAS**

Viscosidade: aprox. 60000 cPs
Peso específico: 1,2 g/cm³
Proporção de sólidos: 65%
Ponto de fulgor: 64°C

Cores disponíveis: Azul Gen.001 e Cinza Gen.002

# **PREPARAÇÃO**

- Do substrato: Toda a superfície a receber o produto deve estar isenta de resíduos como graxa, gordura, óleo, oxidação, etc.
- Da tinta: É fornecida pronta para uso e deve ser bem misturada. Diluir somente quando necessário, utilizando Solvente para Etch J.1310 se o clima for frio e úmido; ou Retardador para Etch J.1315 se o clima for quente e seco, até a viscosidade ideal para o trabalho.
- Da matriz: Poliéster monofilamento 120-150 fios. Utilizar Emulsão Foto Screen F.010.
- Limpeza da matriz: Solvente para Etch J.1310

## MÉTODO DE APLICAÇÃO

Imprimir usando rodo de poliuretano de dureza alta (75-80 shores) com corte vivo, inclinação de 45º, velocidade média e pressão forte.

#### **SECAGEM**

Seca em temperatura ambiente em 30 a 45 minutos. Cura total em estufa à 140°C de 5 a 7 minutos para processo corrosão.

## REMOÇÃO

Mediante banho em solução alcalina diluída, baseada em hidróxido ou carbonato de sódio. A remoção em soluções alcalinas concentradas pode exigir uma posterior lavagem com jato de água, sob alta pressão.